

Kemet PR3 Plate

ケメットPR3プレートは英国ケメット社70年の経験を元に樹脂のみを固めて製造したピュアレジンプレートです。樹脂のみで製造しておりますので金属コンタミを低減させることが出来るため半導体関連部品のポリッシュや、これまでパッドを用いてポリッシュしていた工程への導入が期待出来ます。ハード定盤のため面ダレを低減させることも出来ます。

【使用可能な研磨剤】

- ・ 酸化セリウム
- ・ シリカ
- ・ アルミナ
- ・ ダイヤモンド
- ・ その他 etc.



【光学ガラス研磨例：酸化セリウム使用】

プレート・径	ケメットPR3プレート φ380mm
素材（ワーク）	光学ガラス
サイズ	φ25mm×3mmT
ポリシングレート	0.47μ/min
面粗度・ポリッシュ前	Ra=0.3μm（接触式測定器）
面粗度・ポリッシュ後	Ra=0.01μm（Z y g o）
平面度	0.1μm以下
外観（目視）	スクラッチフリー
メンテナンス	ダイヤモンドドレッサー使用可能

Kemet

ケメット・ジャパン株式会社
千葉県千葉市花見川区犢橋町1614-27
TEL:043-301-5408 E-mail:info@kemet.jp